

基盤技術研究促進事業(民間基盤技術研究支援制度)

平成 17 年度中間評価結果

平成 18 年 3 月 29 日

研究開発推進部

平成 17 年度は、平成 15 年度採択の 3 プロジェクトに対して中間評価を実施した。評価結果及び対応方針は以下のとおりである。

【総合評価結果とその対応基準】

総合評価	総合評価対応
S	委託者の希望に応じ、可能な範囲で積極的な推進を図る
A	原則として現状の計画に沿って、継続案件とする
B	研究を精査・再構築することを条件に継続案件とする
C	中止する

【中間評価結果】

分野	受付番号	テーマ名	委託先	総合評価	中間評価結果内容	
					技術評価所見	事業化可能性評価所見
ナノ テク ・ 材料	15K018	超高濃度オゾン活用の高品質Si酸化膜低温形成技術と装置の開発	株式会社明電舎	A	高濃度オゾンによるSiの低温酸化膜形成技術は日本独自のものであり、学術的にも大変興味深く、他分野への波及効果も期待される。この分野は非常にミクロな領域を評価する技術等とともに発展しており、日本における各方面の先端技術を駆使することにより、革新的な半導体デバイスの開発が期待される。	電子材料の生産工程の効率化・発展に一定の寄与が期待できる。今後、研究開発スピードの加速、事業化計画の具体化と商品化のスピードアップが望まれる。また事業リスク管理上、より広い視点から適用市場を開拓し、早期に投資の回収を行うことを期待する。
	15K205	近接場利用次世代カソードルミネッセンス及びラマン分光装置開発	株式会社東レリサーチセンター、 株式会社日立ハイテクノロジーズ、 株式会社フotonデザイン	A	概ね基本計画通りに着実に進捗しており、中間目標もほぼ達成されている。本研究開発は、世界的に見ても最先端の開発目標を持ち、内容的にもユニークな分析装置を開発しようとするもので、これが実現できれば関係する様々な分野に与える影響は大きいものと思われる。	本研究開発による測定技術のブレークスルーが達成できれば、ナノテク市場の拡大が期待でき、外部への経済波及効果も大きいものと思われる。材料、形状分析法も個別化する傾向があるが、周辺技術の革新と連携が必要であり、企業、研究機関の壁を超えるプロジェクトが重要になる。このような意味では、本研究テーマは適合性が高く、じっくり育てたいテ

						ーマであり、次の段階の発展(適用領域拡大)が期待できる。
製造技術等	15K241	高度製造技術と革新的設計の融合による汎用小型衛星の研究開発	東大阪宇宙開発共同組合	A	研究体制、研究の内容と成果、技術的意義は、ほぼ妥当と考えられる。中小企業を主体とした新しい衛星開発は、日本の宇宙産業に新風をもたらすものと期待される。全体として事業の目標が高く意義深いことから、本プロジェクト事業を継続すべきである。	大企業だけが参入可能とされてきた宇宙ビジネスに中小企業が産学連携で挑戦するという、きわめて意欲的かつ有為なプロジェクトであり、かつ委託先それぞれが持つノウハウは評価しうる。中小企業の構造転換の一つの解への挑戦として公的支援をする価値のあるプロジェクトである。今後は、競争力を確保する戦略を立てる上でも強力なスポンサーなど、追加的な事業化参加者が望まれる。

※B評価については、改善指摘事項の対処を再評価するため、当該事項の対処が速やかに対応可能かどうか注意到意すること。